

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成20年2月14日(2008.2.14)

【公表番号】特表2007-517845(P2007-517845A)

【公表日】平成19年7月5日(2007.7.5)

【年通号数】公開・登録公報2007-025

【出願番号】特願2006-548376(P2006-548376)

【国際特許分類】

A 6 1 K 8/25 (2006.01)

A 6 1 K 8/26 (2006.01)

A 6 1 Q 11/00 (2006.01)

【F I】

A 6 1 K 8/25

A 6 1 K 8/26

A 6 1 Q 11/00

【手続補正書】

【提出日】平成19年12月19日(2007.12.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

歯磨き剤組成物に用いる研磨剤系であって、30～300の範囲の放射性歯科用研磨(RDA)と40～150cm³/100gの範囲の吸油量と、3～15μmの範囲の重量平均粒度とを有する少なくとも1種の研磨剤の非晶質シリカと、0.2μm以下の平均微結晶寸法を有する結晶質のアルミノケイ酸塩とを含有してなる研磨剤系。

【請求項2】

30～150の範囲の放射性歯科用研磨(RDA)と、60～140cm³/100gの範囲の吸油量と5～15μmの範囲の重量平均粒度とを有する摩耗性の非晶質シリカ(ここではシリカAと示す)及び/又は100～300の範囲の放射性歯科用研磨(RDA)と40～150cm³/100gの範囲の吸油量と3～15μmの範囲の重量平均粒度とを有する摩耗性の非晶質シリカ(ここではシリカBと示す)を含有してなる請求項1記載の研磨剤系。

【請求項3】

シリカBは少なくとも100のRDAを有する請求項2記載の研磨剤系。

【請求項4】

アルミノケイ酸塩は次式： $M_{2/n}O \cdot Al_2O_3 \cdot xSiO_2 \cdot yH_2O$ を有する請求項1～3の何れかに記載の研磨剤系。

【請求項5】

アルミノケイ酸塩はゼオライトPである請求項1～4の何れかに記載の研磨剤系。

【請求項6】

x は1.8～2.4の範囲の値を有する請求項4記載の研磨剤系。

【請求項7】

アルミノケイ酸塩は0.1μm以下の微結晶寸法を有する請求項1～6の何れかに記載の研磨剤系。

【請求項8】

結晶質アルミノケイ酸塩のRDAは120以下である請求項1～7の何れかに記載の研磨剤系

。

【請求項 9】

結晶質のアルミニノケイ酸塩は次式 ; $M_{2/n}O \cdot Al_2O_3 \cdot xSiO_2 \cdot yH_2O$ (但し M はアルカリ金属塩であり、該アルカリ金属 M の少なくとも一部分は 1 種又はそれ以上の別の金属部分で交換されている) を有するゼオライト P から誘導される請求項 1 ~ 8 の何れかに記載の研磨剤系。

【請求項 10】

シリカ A とシリカ B との両方が存在し、シリカ A は研磨剤系の合したシリカ研磨剤 / アルミニノケイ酸塩含量の少なくとも 25 重量 % よりなり、シリカ B は合したシリカ A / シリカ B / アルミニノケイ酸塩全体の少なくとも 2 重量 % よりなる請求項 2 ~ 9 の何れかに記載の研磨剤系。

【請求項 11】

100 ~ 300 の範囲の RDA を有する清浄用促進剤として作用する相異なる結晶質アルミニノケイ酸塩を更に含有してなる請求項 1 ~ 10 の何れかに記載の研磨剤系。